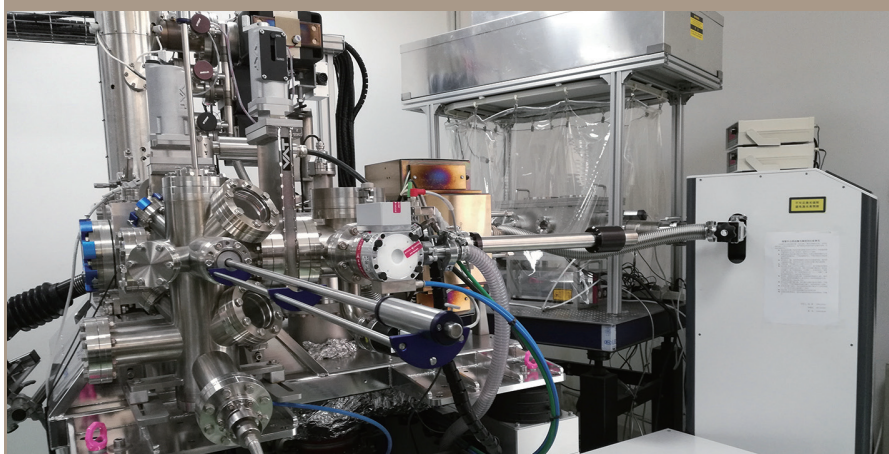


深紫外激光光发射电子显微镜

Deep Ultraviolet Diode-pumped Solid State Laser Photoemission Electron Microscope

DUV-DPL PEEM



主要技术与性能指标

● PEEM 分辨率: $\leq 10 \text{ nm}$

● LEEM 分辨率: $\leq 5 \text{ nm}$

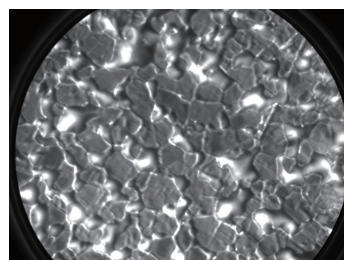
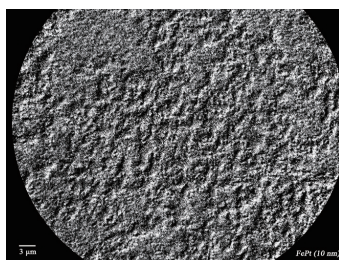
● 能量分辨率: $\leq 0.2 \text{ eV}$

主要应用

表面分析科学中的表面磁学、表面催化、薄膜生长等

代表性应用成果

用于 MgO/Pt/FePt 磁性薄膜成像



用于钨钨阴极材料成像

主要用户单位	中国科学院大连化学物理研究所、北京中科科仪股份有限公司、中国科学院电子学研究所、中国科学院物理研究所、中国科学技术大学		
研制单位	中国科学院理化技术研究所、北京中科科仪股份有限公司、中国科学院大连化学物理研究所		
联系方式	张申金 孙占峰	010-82543470, 13488671978 010-82548109, 13520785335	zhangshenjin@163.com zhfsun@kyky.com.cn